

- 貯湯槽で 60℃以上、吹き出し口で 55℃以上の熱湯を給湯する。^{591, 592}(IVA)
- 5.3 レジオネラ感染症が施設内で発生した場合は、浴槽、リハビリ用プール、シャワーの蓮口などの湿潤箇所の培養検査と検出箇所の使用禁止、衛生管理を徹底する。(III A)
- 5.4 レジオネラの院内感染防止には、銅-銀イオン化システムを利用する方が良い。⁵⁹³(II B)
- 6 *Clostridium difficile*、ノロウイルスなど糞便、吐物を介して感染する病原体
- 6.1 *C. difficile*: 患者は個室収容かコホーティングを行い、汚染・伝播防止策(標準的な感染予防策、接触感染予防策)の徹底、排便介助、オムツ交換、糞便処理の際の手指衛生の徹底、通常洗剤により、手が触れる箇所の定期的拭き取りによる芽胞の物理的除去、高濃度汚染が疑われる場合は、次亜塩素酸 Na などを用いて消毒する。(II A)
- 6.2 ガチフロキサシン、モキシフロキサシンの投与後に分離された株は、北米で流行している強毒型の B I /NAP1/027 株か否か検査する方が良い。(II B)
- 6.3 重篤な腸管感染症状を呈する患者では強毒型の B I /NAP1/027 株を想定し、培養検査を行方が良い。(II B)
- 6.4 ノロウイルスでは患者は個室収容かコホーティングし、汚染・感染防止策(標準的な感染予防策、接触感染予防策)を徹底する。(III A)
- 6.5 下痢、嘔吐物の処理時には、次亜塩素酸 Na などの消毒剤(塩素濃度 200ppm)を使用する。⁵⁹⁴(II A)
- 7 消毒薬に抵抗性を示す細菌
- 7.1 *C. difficile*、バチルス属菌など芽胞を形成する菌種に対しては、一般の消毒処置が無効であるため、手が触れやすく、汚染されやすい箇所を通常洗剤を用いて定期的に物理的な拭き取りによる除染を行う。(II A)
- 7.2 芽胞の汚染が想定される場合には、次亜塩素酸 Na を含む消毒剤を用いた消毒を行う。(II A)
- 7.3 1.1 クロルヘキシジンに抵抗性を示す *Burkholderia cepacia* やブドウ糖非発酵菌群によるアウトブレイクが発生した場合には、消毒薬の使用が使用説明書通りに行われているかの点検を行い、湿潤箇所の拭き取り検査、さらに消毒薬抵抗性株の出現を考慮して対策を行う方が良い。(III B)
- 8 食品を介して感染する可能性のある病原体
- 8.1 ノロウイルス、サルモネラ、腸管出血性大腸菌(O157 など)カンピロバクターなど、汚染された食品を介して感染する可能性のある病原体による感染症が同時多発した場